

# Aka-Brief #21 Céramique revêtue par pulvérisation thermique

1						
	Piatto 220+	Water	300 rpm	30 N	Until plane	BF, 100x
2						
	Allegran 3	DiaUltra 6 µm	150 rpm	35 N	4:00 min	BF, 100x
3						
	Silk	DiaUltra 3 µm	150 rpm	30 N	3:00 min	BF, 100x
4						
	Chemal*	Colloidal Silica 50 nm Alkaline	150 rpm	15 N	5:00 min**	BF, 100x

Les temps sont indiqués pour un système de préparation de 300 mm et les forces pour un échantillon individuel de 40 mm de diamètre.

Sur un système de 250 mm, les temps doivent être augmentés de 30 %, sur un système de 200 mm de 100 %.

La force doit être augmentée pour les échantillons plus grands et diminuée pour les échantillons plus petits.

La vitesse de rotation de la tête (porte-échantillon ou plaque porte-échantillon) utilisée est de 150 tr/min.

Le temps et la force peuvent varier en fonction de l'équipement.

\* Avant le polissage aux oxydes, le tissu de polissage doit être mouillé avec de l'eau jusqu'à ce que le support touche le tissu de polissage. Pendant les 10 dernières secondes de l'étape de polissage à l'oxyde, le drap de polissage doit être

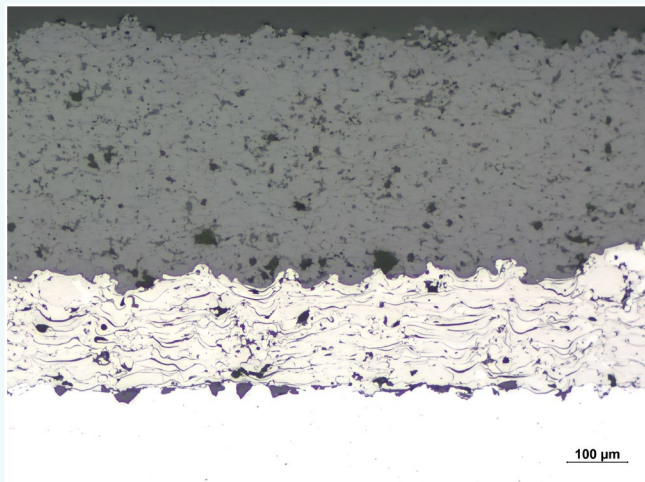
flusher le drap de polissage avec de l'eau afin de nettoyer à la fois le(s) échantillon(s) et le drap de polissage.

\*\* Pour d'autres pièces revêtues de céramique par pulvérisation thermique, le temps de polissage de l'oxyde peut devoir être augmenté.

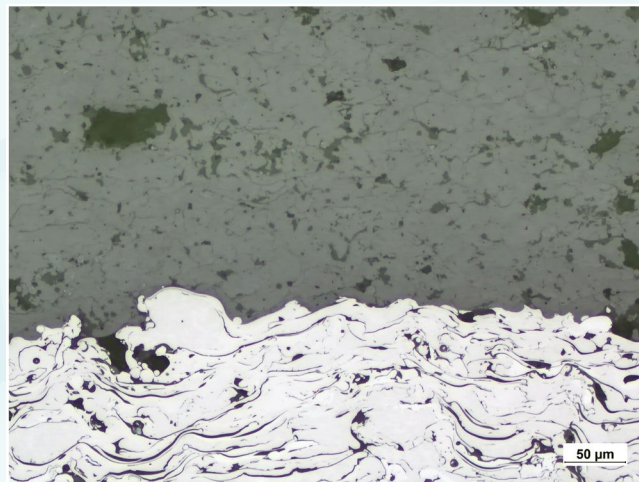
# SOMEKO

# Aka-Brief #21 Céramique revêtue par pulvérisation thermique

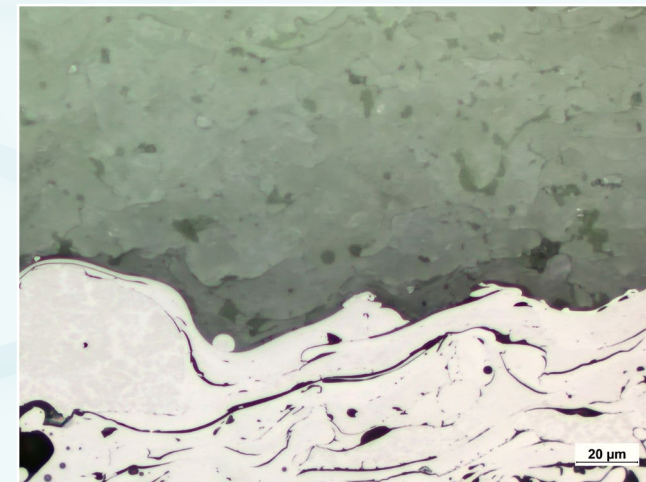
## RÉSULTAT FINAL



Thermal barrier coatings with ceramic top and metallic bond, BF, 100x



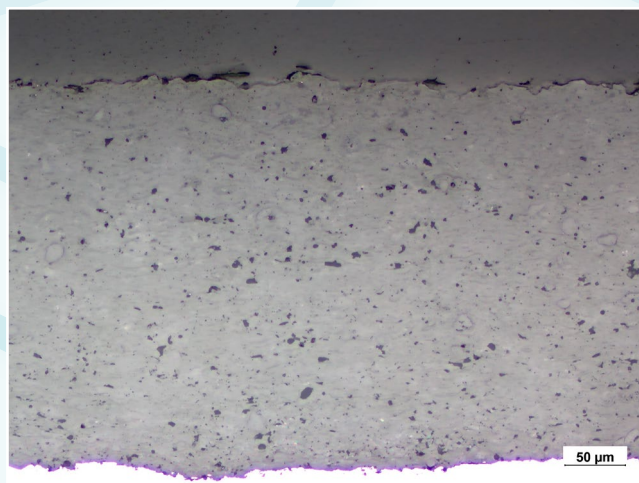
Thermal barrier coatings with ceramic top and metallic bond, BF, 200x



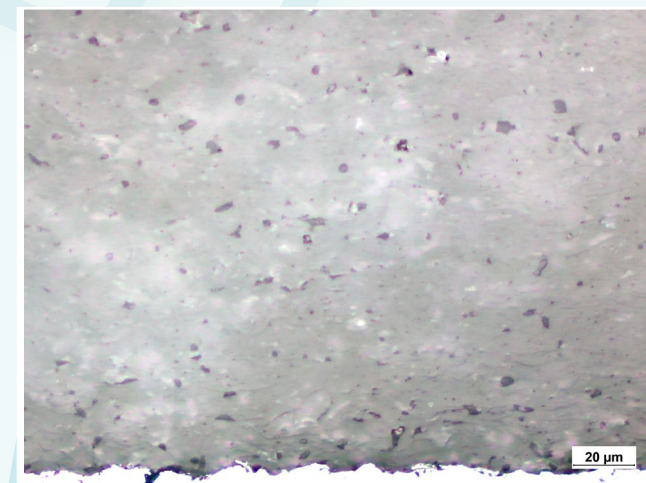
Thermal barrier coatings with ceramic top and metallic bond, BF, 500x



Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> coating on a steel substrate, BF, 100x



Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> coating on a steel substrate, BF, 200x



Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> coating on a steel substrate, BF, 500x